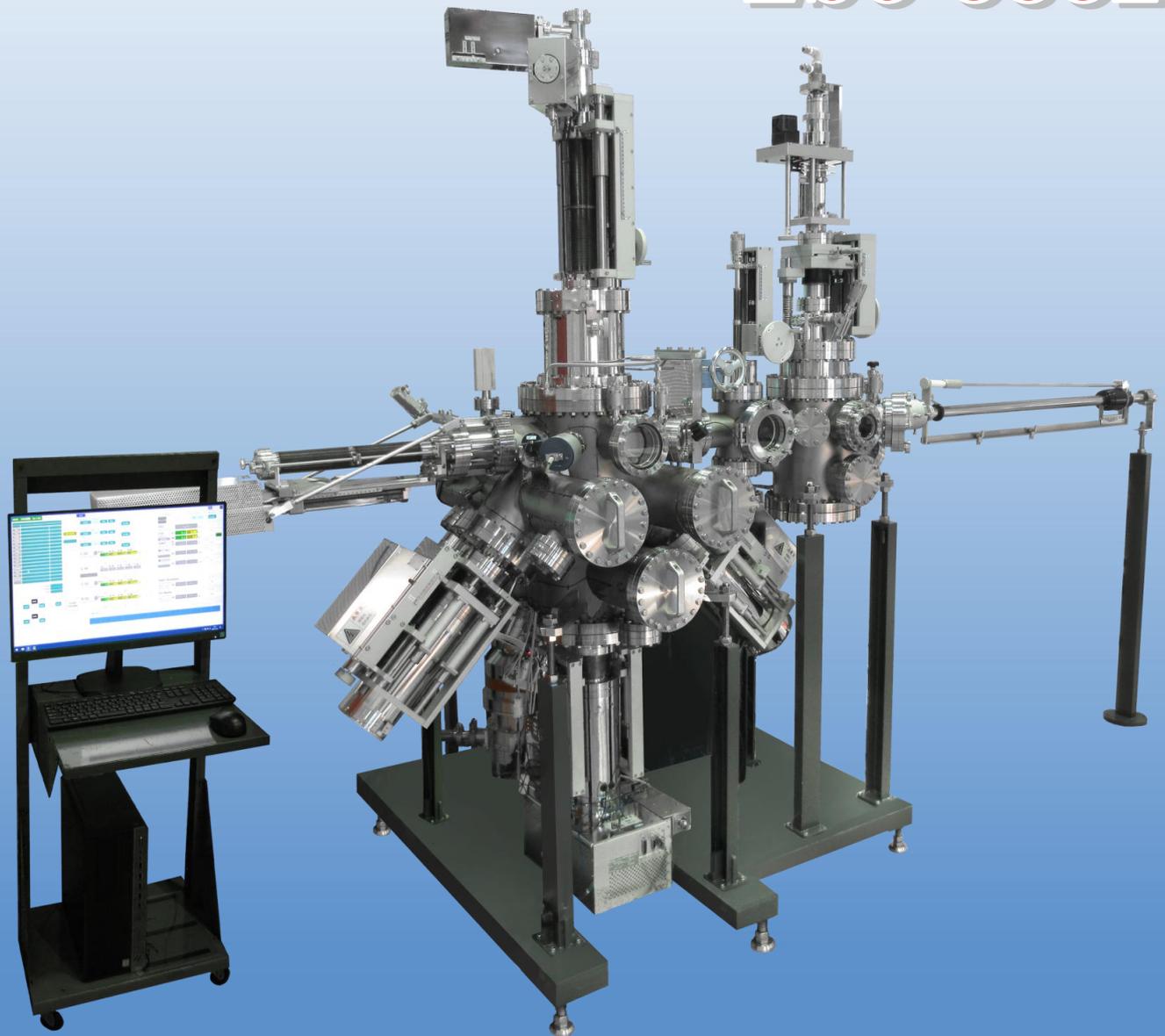


# セレクトティブスパッタリング装置 Selective Sputtering System

## ESC-333L



### ■特長

1. 超高真空対応のスパッタ装置です。
2. 複数のターゲットをスライドさせ、自由にターゲットの材料を選択してスパッタ成膜できます。
  - ・ 真空の状態でもターゲット選択可能です
  - ・ 1つのスパッタ源で複数のターゲットがスパッタ成膜可能です
3. チャンバー径が小さくできる構造なので、低価格設定です。
4. 設置スペースが小さくできます。
5. オプションで自動成膜・搬送ソフト、スパッタ源、蒸着源などが取付可能です。